

特許協力条約

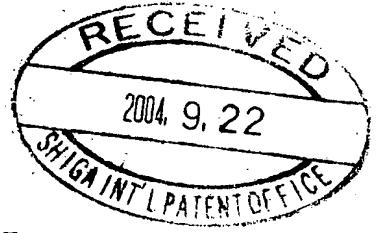
発信人 日本国特許庁（国際調査機関）

出願人代理人
棚井 澄雄

あて名

〒 104-8453
東京都中央区八重洲2丁目3番1号

様

PCT
国際調査機関の見解書
(法施行規則第40条の2)
[PCT規則43の2.1]発送日
(日.月.年)

21.9.2004

出願人又は代理人
の書類記号

PCT-9177

今後の手続きについては、下記2を参照すること。

国際出願番号 PCT/JP2004/008282	国際出願日 (日.月.年) 08.06.2004	優先日 (日.月.年) 11.06.2003
-----------------------------	-----------------------------	---------------------------

国際特許分類 (IPC)

Int. C17 G03F 7/075, 7/039

出願人 (氏名又は名称)
東京応化工業株式会社

1. この見解書は次の内容を含む。

- 第I欄 見解の基礎
- 第II欄 優先権
- 第III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成
- 第IV欄 発明の単一性の欠如
- 第V欄 PCT規則43の2.1(a)(i)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
- 第VI欄 ある種の引用文献
- 第VII欄 国際出願の不備
- 第VIII欄 国際出願に対する意見

2. 今後の手続き

国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国際予備審査機関がPCT規則66.1の2(b)の規定に基づいて国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。

この見解書が上記のように国際予備審査機関の見解書とみなされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日から3月又は優先日から22月のうちいずれか遅く満了する期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当な場合は補正書とともに、答弁書を提出することができる。

さらなる選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照すること。

3. さらなる詳細は、様式PCT/ISA/220の備考を参照すること。

見解書を作成した日

06.09.2004

名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員) 伊藤 裕美	2H	9515
---	---------------------------	----	------

電話番号 03-3581-1101 内線 3230

第 I 欄 見解の基礎

1. この見解書は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎として作成された。

この見解書は、_____語による翻訳文を基礎として作成した。
それは国際調査のために提出されたPCT規則12.3及び23.1(b)にいう翻訳文の言語である。

2. この国際出願で開示されかつ請求の範囲に係る発明に不可欠なヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、以下に基づき見解書を作成した。

- a. タイプ
 - 配列表
 - 配列表に関連するテーブル
- b. フォーマット
 - 書面
 - コンピュータ読み取り可能な形式
- c. 提出時期
 - 出願時の国際出願に含まれる
 - この国際出願と共にコンピュータ読み取り可能な形式による
 - 出願後に、調査のために、この国際調査機関に提出された

3. さらに、配列表又は配列表に関するテーブルを提出した場合に、出願後に提出した配列若しくは追加して提出した配列が出願時に提出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

4. 補足意見：

第IV欄 発明の単一性の欠如

1. 追加手数料納付の求め（様式PCT/ISA/206）に対して、出願人は、

- 追加手数料を納付した。
- 追加手数料の納付と共に異議を申立てた。
- 追加手数料の納付はなかった。

2. 国際調査機関は、発明の単一性の要件を満たしていないと判断したが、追加手数料の納付を出願人に求めないとした。

3. 国際調査機関は、PCT規則13.1、13.2及び13.3に規定する発明の単一性を次のように判断する。

- 満足する。
- 以下の理由により満足しない。

請求の範囲1, 2と請求の範囲3-5とは、必須の構成成分が異なる。
また、共通する構成単位の共重合体を有するものは、明らかに公知である。

4. したがって、国際出願の次の部分について、この見解書を作成した。

- すべての部分
- 請求の範囲 _____ に関する部分

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についてのPCT規則43の2.1(a)(i)に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲	1 - 10	有
	請求の範囲		無
進歩性 (I S)	請求の範囲	1 - 10	有
	請求の範囲		無
産業上の利用可能性 (I A)	請求の範囲	1 - 10	有
	請求の範囲		無

2. 文献及び説明

文献1 ; JP 2001-51422 A (東京応化工業株式会社)
2001. 02. 23, 特許請求の範囲, 段落番号0013-0030, 0058
(ファミリーなし)

文献2 ; JP 2002-55452 A (東京応化工業株式会社)
2002. 02. 20, 請求項1-7, 段落番号0058, 0076, 0077
& US 2002/0025495 A1

文献3 ; WO 02/091083 A1 (SHIPLEY COMPANY, L. L. C.)
2002. 11. 14, 全文 & EP 1407324 A1

文献4 ; JP 8-29986 A (株式会社日立製作所)
1996. 02. 02, 段落番号0001-0006, 0015, 0071-0079, 図3
(ファミリーなし)

文献5 ; JP 2001-265006 A (ティーディーケイ株式会社)
2001. 09. 28, 段落番号0007-0009, 0058 (ファミリーなし)

文献6 ; JP 63-101427 A (株式会社日立製作所)
1988. 05. 06, 特許請求の範囲, 第1頁右下欄第12行-第2頁右上
欄第7行 (ファミリーなし)

文献7 ; JP 63-90534 A (株式会社日立製作所)
1988. 04. 21, 全文 (ファミリーなし)

文献8 ; JP 62-96526 A (株式会社日立製作所)
1987. 05. 06, 全文
& EP 0204963 A2

請求の範囲1、2、7に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1-3に記載されているので、新規性、進歩性を有しない。

請求の範囲3-5、7に係る発明は、文献3に記載されているに等しい事項であるから、新規性、進歩性を有しない。

また、国際調査報告で引用された文献1及び周知技術により、進歩性を有しない。文献1において、酸解離性抑制基として、周知のシクロヘキシリオキシエチル基等を選択することは、当業者にとって容易である。

第VI欄 ある種の引用文献

1. ある種の公表された文書(PCT規則43の2.1及び70.10)

出願番号 特許番号	公知日 (日.月.年)	出願日 (日.月.年)	優先日 (有効な優先権の主張) (日.月.年)
WO 2004/055598 A1 [EX]	01.07.2004	01.12.2003	02.12.2002
JP 2004-38143 A [PX]	05.02.2004	28.02.2003	03.03.2002

2. 書面による開示以外の開示(PCT規則43の2.1及び70.9)

書面による開示以外の開示の種類	書面による開示以外の開示の日付 (日.月.年)	書面による開示以外の開示に言及している 書面の日付 (日.月.年)

第VII欄 国際出願に対する意見

請求の範囲、明細書及び図面の明瞭性又は請求の範囲の明細書による十分な裏付についての意見を次に示す。

請求の範囲3, 5に記載された発明は、請求の範囲4に記載されているようなフェニルシルセオキサン単位を有するもの以外は記載されていない。

本願の趣旨からして、請求の範囲4に記載されているようなフェニルシルセオキサン単位は必須の構成成分とする以外の発明は記載されていない。

補充欄

いづれかの欄の大きさが足りない場合

第 V.2 欄の続き

請求の範囲 6 に係る発明は、文献 1 - 3 に記載されているに等しい事項であるから、新規性、進歩性を有しない。

文献 1 には、溶解抑制剤に相当する化合物を添加することが記載されている。

また、ポジ型フォトレジストにおいて、溶解抑制剤を添加することは、周知慣用技術であり、適宜なし得ることである。

請求の範囲 8 に係る発明は、文献 1 - 3 に記載されているので、新規性、進歩性を有しない。

文献 1 - 3 には、「磁性膜の上側」に設けられるレジスト層の形成用であることは記載されていない。しかしながら、これにより、「ポジ型レジスト組成物」の構成を何ら限定するものではない。

また、フォトレジストをこのような用途に用いることは、国際調査報告で引用された文献 4, 5 により、周知である。

請求の範囲 9、10 に係る発明は、文献 1 - 3 に記載されているので、新規性、進歩性を有しない。

文献 1 の段落 0029、文献 2 の段落 0058、文献 3 の第 32 頁第 9 - 21 行にその適する厚さ等が記載されている。

なお、国際調査報告で引用された文献 6 - 8 に記載されているように、従来より、シリセオキサン骨格のフォトレジストを、耐ドライエッチング性に優れ、2 層レジスト法の上層レジストとして用いられるることは、周知である。